

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 19 年 6 月 21 日 (2007.6.21)

【公開番号】特開 2001-319910 (P2001-319910A)  
 【公開日】平成 13 年 11 月 16 日 (2001.11.16)  
 【出願番号】特願 2000-135224 (P2000-135224)  
 【国際特許分類】

**H 0 1 L 21/304 (2006.01)**

**B 0 8 B 3/02 (2006.01)**

**H 0 1 L 21/027 (2006.01)**

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 3 A

B 0 8 B 3/02 C

H 0 1 L 21/30 5 7 7

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 5 月 7 日 (2007.5.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被処理体を保持し、かつ、該被処理体を該被処理体の平面上で回転可能な被処理体保持手段と、

前記被処理体の一方の面側に配置され、前記被処理体保持手段が前記被処理体を保持し、かつ、回転させている状態で、該被処理体の他方の面に、該被処理体の他方の面の周縁に所定の処理を施すための処理液を供給する処理液供給手段と、

前記被処理体の他方の面側に配置され、前記処理液供給手段により供給された処理液の、前記被処理体の他方の面中心部への回り込みを抑制する、回り込み抑制手段とを備えることを特徴とする液処理装置。

【請求項 2】

前記回り込み抑制手段は、前記被処理体のいずれかの面に近接して配置された部材から構成されていることを特徴とする、請求項 1 に記載の液処理装置。

【請求項 3】

前記回り込み抑制手段は、流体を前記被処理体のいずれかの面の周縁に向けて噴射することを特徴とする、請求項 1 に記載の液処理装置。

【請求項 4】

前記回り込み抑制手段は、前記被処理体の周縁から内方への回り込みを抑制する手段から構成されることを特徴とする、請求項 1、2 又は 3 に記載の液処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

本発明に係る液処理装置は、

被処理体を保持し、かつ、該被処理体を該被処理体の平面上で回転可能な被処理体保持

手段と、

前記被処理体の一方の面側に配置され、前記被処理体保持手段が前記被処理体を保持し、かつ、回転させている状態で、該被処理体の他方の面に、該被処理体の他方の面の周縁に所定の処理を施すための処理液を供給する処理液供給手段と、

前記被処理体の他方の面側に配置され、前記処理液供給手段により供給された処理液の、前記被処理体の他方の面中心部への回り込みを抑制する、回り込み抑制手段とを備えることを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

上記液処理装置において、前記回り込み抑制手段は、流体を前記被処理体のいずれかの面の周縁に向けて噴射してもよい。

また、前記回り込み抑制手段は、例えば、前記被処理体の周縁から内方への回り込みを抑制する。